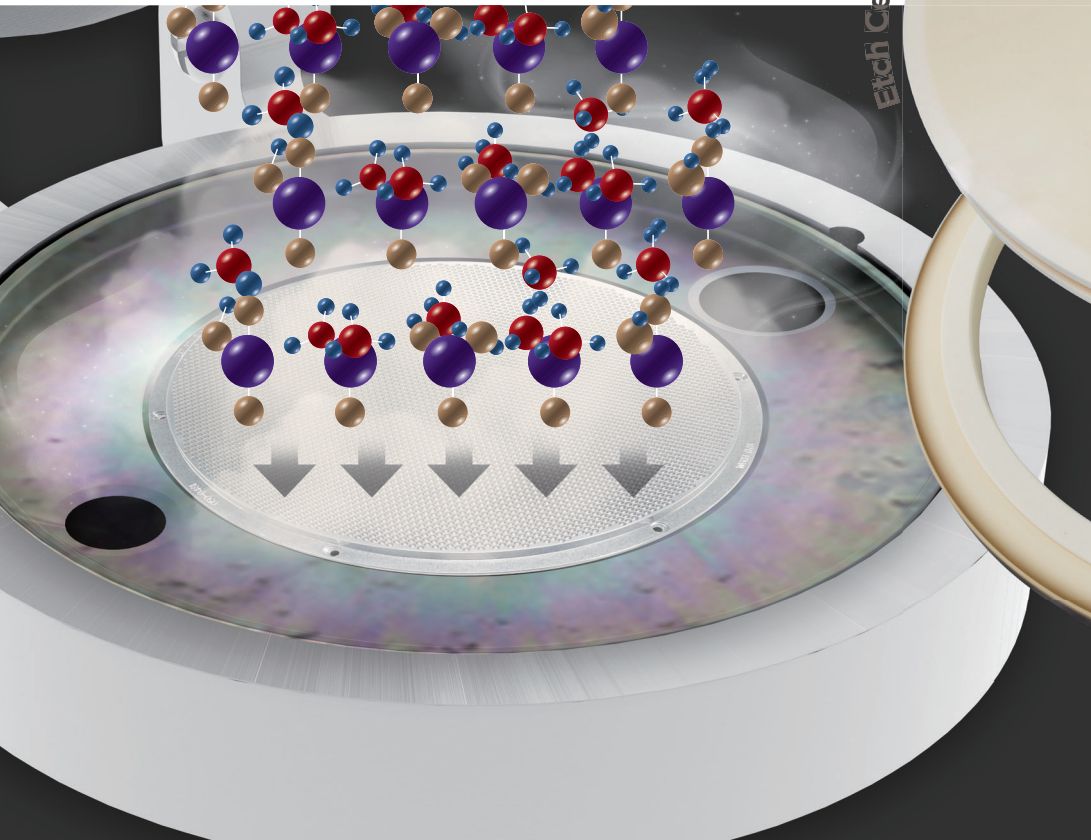


CINOS COATING TECHNOLOGY

A-ZERON™

A-ZERON™ Coating은 원자를 적층하여 코팅을 형성하는 ALD(Atomic Layer Deposition)으로 Precursor와 Reactant를 반복적으로 주입, 배기하여 **원자 단위로 층을 적층하여 성막을 형성하는 기술입니다.**

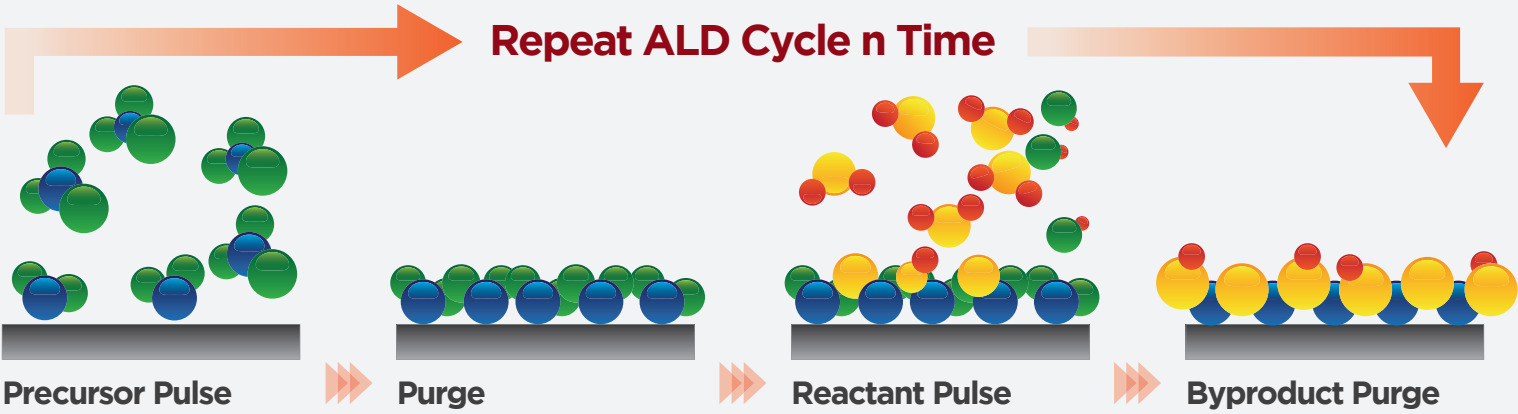
A-ZERON™ Coating은 기타 박막 형성 방법인 PVD, CVD 법에 비해 **코팅 밀도, 접착력이 높고 공정 온도가 낮습니다.**



CVD Showerhead

Etch Ceramic Window

Edge Ring



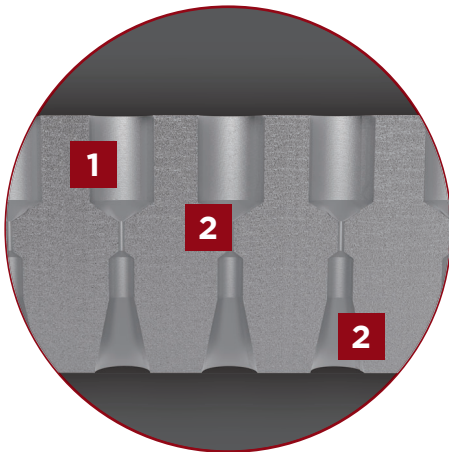
Al₂O₃ Coating

A-ZERON™ Al₂O₃ Coating은 TMA*(Al(CH₃)₃)를 Precursor(전구체)로 H₂O를 Reactant(반응체)로 사용해 Al₂O₃ 성막을 형성합니다.

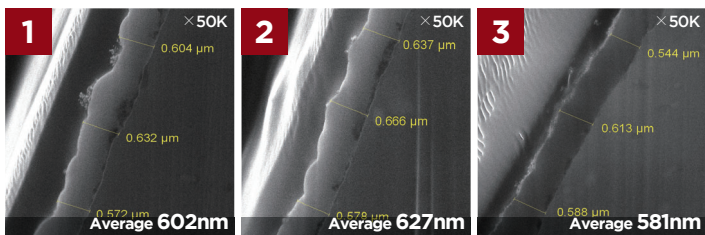
A-ZERON™ Al₂O₃ Coating은 CVD 공정의 Showerhead Hole 내부 및 전면에 균일한 Coating층을 형성하여 표면 경도 증가, CVD 공정에 사용되는 Gas와의 반응성을 감소시켜 부품의 공정 사용 시간 및 재사용 주기를 연장시킵니다.

* TMA : Tri Methyl Aluminium

Mechanism



ALD Coating Showerhead Hole Step Coverage



Y₂O₃ Coating

A-ZERON™ Y₂O₃ Coating은 100nm 수준의 Coating이 가능하며 600nm 이상의 Grain Size를 가지고 있어 내화학저항성, 내플라즈마 저항성이 강합니다.

